

2019年3月19日

高解像度 X 線イメージング検出器の開発

当社は、高輝度光科学研究センター（JASRI）計測技術開発チームの亀島敬研究員（理化学研究所 放射光科学研究センター データ処理系開発チーム 客員研究員）と、理化学研究所 放射光科学研究センター データ処理系開発チームの初井宇記チームリーダーが行った、200 ナノメートルの構造を解像できる高解像度 X 線イメージング検出器の開発に参画致しました。

この高解像度 X 線イメージング検出器は、これまでできなかった X 線撮像の理論限界に近い 200 ナノメートルの解像力を世界で初めて実現しました。この検出器には、当社が開発に成功した接合 LuAG セラミックスシンチレータがキーデバイスとして使用されています。

今後も当社は、使用用途が広がる透明・接合セラミックス製造や、薄膜研磨加工など、高度な技術で社会に貢献できるよう努力してまいります。

詳細は SPring-8 のホームページをご覧ください。

(http://www.spring8.or.jp/ja/news_publications/press_release/2019/190315/)



開発したX線イメージング検出器
※SPring-8ホームページ写真転載



接合LuAGセラミックスシンチレータ